

化学工学会材料・界面部会共通基盤技術シンポジウム2014 報告書
材料・界面部会 事務局 脇原徹

化学工学会材料・界面部会共通基盤技術シンポジウム2014が2014年12月5日(金)に東京大学にて開催された。本シンポジウムは各種材料プロセスを横断するような共通課題(基盤技術)について議論する場を提供することを目的とし、各研究・技術における共通性を見だし、学会と産業界との連携を図り、基盤技術の体系化を図ることを目的としたものである。上記の目的のため、特に企業からの参加者を募ることに注力した結果、事前登録が162名(当日参加160名)という盛会となった。具体的には、企業から46社、大学から19研究室の参加があった。発表の詳細は後述のシンポジウム案内をご参考頂きたい。また、シンポジウム後の交流会も90名近くの参加者があり、活発な意見交換がなされていた。今回、シンポジウムが盛会であった要因として、まさに”共通基盤技術“をトピックスとしたことが挙げられる。今後、材料・界面部会から他の”共通基盤技術“をトピックスとしたシンポジウムを継続的開催していくことができれば、産学連携という部会目標の一助のなるものと確信している。



主催：化学工学会材料・界面部会
日時：2014年12月5日(金)13時～17時30分
会場：東京大学 本郷キャンパス 工学部8号館 教授会室
営団地下鉄南北線東大前駅 徒歩5分，営団地下鉄千代田線根津駅 徒歩8分，営団地下鉄丸の内線本郷三丁目駅 徒歩10分
案内図 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_09_j.html
参加費：一般，部会員とも無料（交流会に参加する場合のみ，2,000円）

材料界面部会では各種材料プロセスを横断するような共通課題（基盤技術）について議論する場を，継続的に提供してきています。その議論の中から，各研究・技術における共通性を見だし，学会と産業界との連携を図り，基盤技術の体系化を図ることを目指しています。今回のシンポジウムでは液相粒子分散系における分散技術，特にボール・ミルやビーズ・ミルによる分散技術を取り上げ，いくつかの実施例から分散技術の重要性と材料創製への貢献を知り，体系化に向けた議論を行います。奮ってお申込みいただきますようお願い申し上げます。

プログラム：

- 13:00～13:10 開会の挨拶
材料界面部会長 東京大学 大久保 達也 氏
- 13:10～13:30 「微小ビーズ系での分散エネルギーと製品特性」
ビューラー(株) 前田 真志 氏
- 13:30～13:50 「ナノ粒子向け分散機 MAX ナノ・ゲッターの特徴」
アシザワ・ファインテック(株) 石井 利博 氏
- 13:50～14:10 「微粒子の分散をアシストする湿式粉碎システムの開発」
(株)マキノ 神谷 昌岳 氏
- 14:10～14:50 「シミュレーションを用いた粉碎機中の粒子運動の可視化技術」
(独)産業技術総合研究所 曾田 力央 氏
休憩 (14:50～15:00)
- 15:00～15:40 「粉体分散技術を活用した化粧品製剤・プロセスの開発」
(株)資生堂 那須 昭夫 氏
- 15:40～16:20 「分散・塗布技術による次世代太陽電池の開発」
御国色素(株) 瓦家 正英 氏
- 16:20～17:10 「濃厚コロイド系の流動・乾燥プロセスにおける技術課題」
東京大学 山口 由岐夫 氏
- 17:10～17:30 総合討論

交流会 (17:40～19:00) 場所：工学部2号館展示室